

第34回 薄膜・表面物理基礎講座(2005年)

「ULSI デバイスの研究・開発に必要な先端 分析技術：基礎から応用まで」

(<http://annex.jsap.or.jp/tfspd/>)

協賛 日本物理学会、日本化学会、日本金属学会、日本表面科学会、電子情報通信学会、電気学会、触媒学会、日本真空協会、電気化学会、表面技術協会、日本顕微鏡学会、高分子学会、精密工学会、日本結晶学会、日本結晶成長学会、日本応用磁気学会、日本セラミックス協会(依頼中)

ULSI デバイスの研究・開発現場では、新材料やナノスケールの微細構造を評価するため、最先端の分析技術が必要になってきます。しかし、全ての分析技術を深く理解し、結果を正しく解釈することは容易ではありません。そこで、本講座では、半導体プロセスと分析技術の両方に詳しい先生をお招きし、基礎から最新の応用例まで幅広くご講演いただきます。2日間のプログラムで、製造プロセスの流れと各プロセスに必要な分析技術を把握できるようになっています。また、最新の分析装置の紹介も用意しております。半導体デバイスの研究・開発に携わる若手技術者や研究者にお勧めの講座です。

日時:平成17年11月10日(木) 10:00 - 17:15、11日(金) 9:30 - 16:00

場所:筑波大学 東京キャンパス G501 講義室

東京都文京区大塚三丁目 29-1 TEL: 03-3942-6918 <http://www.tsukuba.ac.jp/navi/tokyo.html>
丸の内線「茗荷谷」駅下車 徒歩2分

プログラム:

日 時	講 演 題 目	講 師
11月10日(木)		
フロントエンド工程		
10:00~11:30	総説 ULSI 開発に不可欠なナノレベル分析評価技術	上田 修(富士通研)
11:30~12:30	昼 食	
12:30~13:45	先端半導体ウェハの表面評価技術	杉山 直治(半導体MIRAIプロジェクト)
13:45~15:00	ゲート絶縁膜およびMOS界面の化学構造および電子状態分析	宮崎 誠一(広島大)
15:00~15:45	最新分析装置の紹介 ・角度分解XPSによる半導体薄膜の深さ構造解析 ・CD AFMの現状と展望 ・最新SEMの機能と応用例の紹介	坂本 文孝(サエック㈱) 鈴木 操(日本ビ-コ) 多持 隆一郎(日立ハイク)
15:45~16:00	休 憩	
16:00~17:15	ULSI デバイスにおける不純物分布分析の現状と将来	片岡 祐治(富士通研)
11月11日(金)		
バックエンド工程		
9:30~11:00	総説 半導体技術ロードマップに見る半導体技術の動向と計測の課題	水野 文夫(明星大)
11:00~12:15	低誘電率層間絶縁膜材料の構造物性分析技術	秦 信宏(産総研)
12:15~13:15	昼 食	
13:15~14:30	リソグラフィにおける評価のニーズと現状	長谷川 昇雄(日立ハイク)
14:30~14:45	休 憩	
14:45~16:00	LSI チップ部の故障解析:光を用いた絞込み技術を中心に	二川 清 (NEC Ⅱヶ口工)

*薄膜・表面物理分科会賛助会社の方は、分科会会員扱いいたします。

**応用物理学会賛助会社の方は、応用物理学会会員扱いいたします。

定員:100名

*現在非会員の方でも参加申込時に薄・表分科会(年会費A:3,000円,B:2,200円)にご入会いただければ、本講座より会員扱いとさせていただきます。下記応物ホームページより入会登録を行い、仮会員番号取得後、本講座に参加お申し込み下さい。入会決定後、年会費請求書をお送りいたします。本講座参加費と同時に振込をさせていただきます。

<http://www.jsap.or.jp/>

申込方法:電子メール、FAX、はがきのいずれかにてお申し込みください。参加費は下記口座に参加者名でお振り込みください。入金確認後、参加証をお送りいたします。申し込み後の取り消し、不参加の場合にも参加費の払い戻しはいたしません。また、請求書の発行は原則として、致しません。領収書はセミナー当日にお渡しいたします。(申込要領:参加者氏名、住所、勤務先、参加費分類・振込額・振込予定日、会員No(仮会員番号)、電話番号、FAX番号、電子メール、参加証送付先(宛名用)(分科会賛助会社 応用物理学会賛助会社の方はその旨明記)

申込先:〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-12-3
井門九段北ビル5F

応用物理学会 分科会担当 伊丹
TEL: 03-3238-1043, FAX: 03-3221-6245
E-mail: divisions@jsap.or.jp

参加費振込先:三井住友銀行 本店営業部(本店も可)
普通預金 9474715
(社)応用物理学会 薄膜・表面物理分科会

申込締切:2005年10月28日(金)

問合せ先:古川 貴司 (株)日立製作所 中央研究所
TEL: 042-323-1111(内 2173) FAX: 042-327-7677
E-mail: furukawt@crl.hitachi.co.jp
宮田 典幸 産業技術総合研究所
TEL: 029-861-2511, FAX: 029-861-2642
E-mail: nori.miyata@aist.go.jp

参加費:テキスト代、消費税含む

薄膜・表面物理分科会会員*	応用物理学会会員**・協賛学協会会員	学生	その他
15,000円	20,000円	3,000円	25,000円

